高分子液晶のせん断流れにおける分子配向挙動の数値シミュレーション

Numerical simulation of molecular orientation behavior of polymeric liquid crystals under shear flows

1 諸言

高分子液晶を利用した液晶プラスティックは、高強度・高 弾性率・低熱膨張率といった特徴を持ち、様々な分野で応用 されている.液晶プラスティックにおけるこれらの特徴は、 高分子液晶における棒状分子の自発的配向性に起因してお り、材料(製品)中の分子配向が秩序を有している.一方、高 分子液晶の分子配向状態は流動に強く依存し、液晶プラステ ィック成形中の流動による影響は成型後の材料においても 維持され、液晶プラスティックの性能に影響する.

図1は液晶プラスティックの線状成形物(直径 0.5mm)の 縦断面の電子顕微鏡画像である.図において,横方向が成形 物の直径方向である.図より,成形物の表面近傍と内部で明 らかな違いが生じており,分子の配向状態が異なることが確 認できる.成形物の表面近傍と内部で分子配向状態が異なる 構造はスキンーコア構造と呼ばれ,液晶プラスティックの性 能低下の要因となっている.スキンーコア構造の発生原因と して考えらているのが,成形時におけるせん断速度の分布で ある.すなわち,高分子液晶が成形型内部を流動する際に, 表面近傍では高せん断流れ,成形物中心近傍では低せん断速 度流れとなり,結果として表面近傍では高配向状態,内部で は低配向状態のスキンーコア構造が形成されたと推察でき る.本研究では,せん断流れ中の高分子液晶の分子配向状態 の関係を明らかにするとともに,液晶プラスティックにおけ るスキンーコア構造の抑制方法についても吟味する.



Fig.1 Electron microscope image of longitudinal section of liquid crystalline fiber

2 支配方程式

液晶分子の配向状態は,主配向方向を表す単位ベクトルn と主配向方向への分子の配向度合いを表す配向秩序パラメ ータSにより表される.これらの物理量を包括するテンソル 量である配向秩序パラメータテンソルSは,一軸対象性を仮 定すると,

$$\mathbf{S} = S\left(\mathbf{nn} - \frac{\mathbf{I}}{3}\right) \tag{1}$$

システム工学群 流体工学研究室 1220005 天野愉心

と表される.ここで,式中のIは単位テンソルである.また, 次式(2)は配向秩序パラメータテンソル理論の時間発展方程 式⁽¹⁾であり,

$$\frac{\mathbf{GS}}{\mathbf{Gt}} = -6D\left\{ \left(1 - \frac{U}{3}\right)\mathbf{S} - U\left[\mathbf{S} \cdot \mathbf{S} - \frac{1}{3}(\mathbf{S};\mathbf{S})\mathbf{I}\right] + U(\mathbf{S};\mathbf{S})\mathbf{S} \right\}
+ \frac{L_1}{\eta}\nabla^2\mathbf{S} + \frac{L_2}{2\eta}\{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{S}) + [\nabla(\nabla \cdot \mathbf{S})]^{\mathrm{T}} - \frac{2}{3}tr[\nabla(\nabla \cdot \mathbf{S})\mathbf{I}\}
+ \frac{2}{3}\beta\mathbf{A} + \beta\left\{\mathbf{A} \cdot \mathbf{S} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{A} - \frac{2}{3}(\mathbf{A};\mathbf{S})\mathbf{I}\right\} - \frac{1}{2}\beta\{(\mathbf{A};\mathbf{S})\mathbf{S}
+ \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{S} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{A} - [(\mathbf{A} \cdot \mathbf{S});\mathbf{S}]\mathbf{I}\}$$
(2)

と表される. ここで, $D (=D_r/(1-3S:S/2)^2)$ は回転拡散係数, G/Gt は共回転微分, Uはネマティックポテンシャル強度, L_1 およ び L_2 はランダウ係数, μ は粘度, β は分子の形状と関係する 形状因子, A は変形速度テンソルである. 式(2)において, 右 辺第1項は短距離秩序効果, 第2項および第3項は長距離秩 序効果, 第4項から第6項は流動による粘性効果を表す. 高 分子液晶の場合, 式(2)中の第2項および第3項は無視でき る.

3 数値計算

次に, せん断流れおよび座標系を以下の図2に示す. せん 断速度流れが x-y 平面内で印加され, せん断速度 $\dot{y} = dv_x/dy$ で与えられる. また, ディレクタnのx軸からのせん断平面 内角度を ϕ , z軸からの角度を θ と定義する.



Fig.2 Shear flow geometry and coordinate systems 式(2)をこの座標系に適用し, *Dr*を用いて無次元化した後, 数値解析を行った.

初期条件として, S(0)=S^{eq}(nono-I/3)を与える. ここで, no=(1,0,0), S^{eq}は平衡状態における秩序度である. 数値計算法 には, 4 次精度のルンゲクッタ法を用いた. 時間刻み幅 ∆t*=0.00001/γ^{*}とした.

以上の条件の下,ネマティックポテンシャル強度 U と分子の形状 β , せん断速度 \dot{y} *をパラメータとして解析を行った.

4 結果および考察

図3に $U=6.0, \beta=0.90, \dot{\gamma}^*=10, 30, 100$ の場合のディレク タのせん断面内角 ϕ の時間変化を示す.図の横軸はひずみ量 ($t^{\dot{\gamma}}$)である. $\dot{\gamma}^*=10$ の場合, $\phi=-90^\circ$ と90°は同一の状態で あるため ϕ は時間の経過とともに減少し続ける.すなわち, ディレクタがせん断平面内で回転し続けるタンブリング挙 動が現れる. $\dot{\gamma}^*=30$ の場合には, $\phi=-50^\circ$ から30°の範囲にお いて一定周期で振動しており,せん断面内で振動し続けるワ ギング挙動を示す.一方, $\dot{\gamma}^*=100$ では, ϕ は一定値に至って おり,せん断流中で,ディレクタが静止するアライニング挙 動を現す.



Fig.3 Director orientation angle ϕ as a function of dimensionless time $t^* \dot{\gamma}^*$

図4にU=6.0, $\beta=0.90$, $\dot{\gamma}^*=50$ の場合の ϕ の時間変化を示 す. 図4(a)より, せん断流れ開始後より ϕ は, ワギング挙動 のような変化をしていたが, $t^*\dot{\gamma}^*=350$ 付近からタンブリン グ挙動のような変化が現れた. そこで, ディレクタのz軸 成分 n_z の時間変化(図4(b))に着目する. n_z は $t^*\dot{\gamma}^*=350$ 付近から急激に増加し, その後, 1をわずかに下回る値近 傍で振動し続ける. すなわち, ディレクタがz軸周りで回 転し続けるカヤッキング挙動を示している.





上記の 4 挙動についてはこれまでの研究によって明らか にされている.一方,本研究では上記の挙動に該当しない挙 動が得られた.図5はU=6.0, $\beta=0.90$, $\dot{\gamma}^*=82$ の場合の,Sを 3次元楕円体として可視化した結果である.楕円体の直交軸 は *S*の固有ベクトルに、軸方向の半径は固有ベクトルに対応 した固有値を表す.すなわち、楕円体の長軸方向がディレク タに相当する.また、楕円体の色は秩序度を表し、*S*=0~1を 緑~赤で示している.座標軸矢印部の色は赤→x軸,緑→y軸, 青→z軸にそれぞれ対応している.*t*^{*}γ^{*}=700.0 においてせん断 平面内の存在するディレクタは、*t*^{*}γ^{*}=720.0 においてせん断 平面外へと逃れ始める.さらに、*t*^{*}γ^{*}=809.0 で*S*が大きく低 下した後、*t*^{*}γ^{*}=813.0 では*S*が再度上昇している.*t*^{*}γ^{*}=800.0 と 813.0 におけるディレクタを比較すると、ディレクタがほ ぼ直交状態にあり、*S*の低下を介してディレクタの主固有ベ クトルの入れ替えが起こっている.すなわち、ディレクタの 不連続変化が生じていると言える.

最後に、図6はネマティックポテンシャル強度 Uとせん 断速度ŷ*と対する分子配向挙動を表す相図を示す. U≦4.5 ではアライニング挙動のみが現れる. U≧5 では、Uの増加 とともにアライニング領域が減少し、同時にタンブリン グ、ワギング、カヤッキング領域が増大する.



Fig.6 Relationship between potential strength U and shear rate as shape function β is 0.90

5 結言

本研究では配向秩序パラメータテンソル理論の時間発展 方程式を用いて,高分子液晶のせん断流れにおける分子配向 挙動の数値シミュレーションを行った.得られた結果を以下 に要約する.

- これまでの研究により明らかとなっていた 4 種類の 挙動に加えて、いずれにも該当しなかった挙動が得ら れた.この挙動において、ディレクタは不連続に変化 する.
- (2) U-ÿ*空間における分子配向挙動を明らかにし、U≦4.5 ではアライニング挙動のみが出現することがわかった.

スキンーコア構造を抑制するためには、管内流れ領域全域 でアライニング挙動を発現させる必要がある。管内流れでは 0から管壁までせん断速度が連続的に発生する。図6の相図 より、 $U \leq 4.5$ ではアライニング挙動のみが発現している。Uは温度 Tの関数として U=3T $_{o}T$ (ただし、T_eは液晶一等方相 転移温度)と与えることができる。すなわち、 $U \leq 4.5$ で成形 するためには成形温度を相転移温度よりもわずかに低く設 定すればよい。しかし、 $\dot{\gamma}^*=0$ を避けることはできずスキン-コア構造の解消にはつながらない可能性がある。そこで、加 えて磁場や電場などの外場を与えることがスキン-コア構 造の解消に繋がると考える。

文献

 Tomohiro Tsuji, Alejandro D. Rey*," Effect of long range order on sheared liquid crystalline materials Part 1: compatibility between tumbling behavior and fixed anchoring" J. Non-Newtonian Fluid Mech., 73(1997) 127-152